

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 7 区分

【発行日】平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)

【公開番号】特開 2005-263336 (P2005-263336A)

【公開日】平成 17 年 9 月 29 日 (2005.9.29)

【年通号数】公開・登録公報 2005-038

【出願番号】特願 2004-74212 (P2004-74212)

【国際特許分類】

B 6 5 G 49/06 (2006.01)

B 0 5 C 5/02 (2006.01)

B 0 5 C 13/02 (2006.01)

G 0 3 F 7/16 (2006.01)

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

B 6 5 G 49/06 Z

B 0 5 C 5/02

B 0 5 C 13/02

G 0 3 F 7/16 5 0 1

H 0 1 L 21/68 A

H 0 1 L 21/30 5 6 2

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 12 月 12 日 (2005.12.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 17

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 17】

前記塗布処理部は、

水平面において基板搬送方向に直交する方向に伸び、帯状に塗布液を吐出するスリット状の塗布液吐出口を有する塗布液供給ノズルと、

前記塗布液供給ノズルに少なくとも洗浄処理を施すノズル洗浄ユニットと、

前記塗布液供給ノズルを、前記基板搬送機構によって搬送される基板に塗布液を供給する位置および前記ノズル洗浄ユニットにアクセスさせるノズル移動機構と、を具備することを特徴とする請求項 6 から請求項 16 のいずれか 1 項に記載の塗布膜形成装置。